mini PFE 100 / 200

Célula limpia física de precisión



Equipo capaz de procesamiento automático continuo de las superficies superior e inferior de piezas de trabajo en forma de tira

La celda pequeña que usa pistola ancha se usa para la industria eléctrica, como placas de circuito impreso o semiconductores. Al procesar ambos lados de manera uniforme, se puede aplicar para forma de barra y forma de hoja. Aplicable para placa de cerámica y Cu.

Característica

- Las funciones están integradas, pero su calidad de procesamiento de chorreado en húmedo sigue siendo la misma. Célula recientemente desarrollada como un propósito de tamaño pequeño y ahorro de costos.
- Las piezas compactas de chorreado y enjuague con agua facilitan el mantenimiento de los actuadores; simplemente abriendo una cubierta del transportador. También el cañón ancho y la bomba como partes principales, aún conservan la alta durabilidad original.
- Línea de 2 tipos (mini PFE 100/200) según el tamaño de la pieza.

Especificaciones

mini PFE 100

Tamaño 1200 (ancho) \times 1250 (profundidad) \times 1600 (alto) mm

Ancho: 20-100 mm Longitud: 100-250 mm Espesor: 0,1-1,5 mm

Velocidad de transporte del transportador 0.1□3.0m/min

tamaño de trabajo

Pistola Pistola ancha de 110 mm Una para cada parte superior e

inferior

Fuente de alimentación AC200V, 50/60Hz, 3 fases

El consumo de energía

Aproximadamente 2,6kW (Potencia aparente nominal total

de todos los equipos)

Presión de suministro de aire 0.5MPa-0.7MPa

Consumo de aire4,1 m³/min (NTP a 0,25 MPa de presión de aire de chorro

preestablecida)

mini PFE 200

Tamaño 1200 (ancho) \times 1650 (profundidad) \times 1650 (alto) mm

Ancho: 20-200 mm Longitud: 100-250 mm Espesor: 0,1-1,5 mm

Velocidad de transporte del

tamaño de trabajo

transportador 0.1 3.0 m/min

Pistola

Fuente de alimentación

El consumo de energía

Presión de suministro de aire

Consumo de aire

Pistola ancha de 220 mm Una para cada parte superior e

inferior

AC200V, 50/60Hz, 3 fases

Aproximadamente 4,3kW (Potencia aparente nominal total

de todos los equipos)

0.5MPa-0.7MPa

7,7 m³/min (NTP a 0,25 MPa de presión de aire de chorro

preestablecida)

Páginas relacionadas

Aplicaciones relacionadas



para enchapado para eliminar rebabas sin dañar los semiconductores



Método de procesamiento para eliminar rebabas finas (rebabas flash) sin dañar el

